

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 21 年 6 月 25 日 (2009.6.25)

【公表番号】特表 2008-545834 (P2008-545834A)

【公表日】平成 20 年 12 月 18 日 (2008.12.18)

【年通号数】公開・登録公報 2008-050

【出願番号】特願 2008-513525 (P2008-513525)

【国際特許分類】

C 0 8 L 101/00 (2006.01)

C 0 8 J 5/22 (2006.01)

H 0 1 M 10/36 (2006.01)

H 0 1 M 8/02 (2006.01)

【F I】

C 0 8 L 101/00

C 0 8 J 5/22 C E R

C 0 8 J 5/22 C E Z

H 0 1 M 10/00 1 1 0

H 0 1 M 10/00 3 0 1 A

H 0 1 M 8/02 P

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 5 月 1 日 (2009.5.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 2

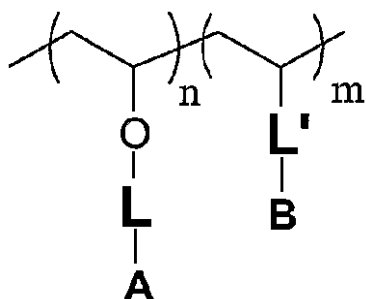
【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 2】

本発明のビニル - エーテルタイプの高分子電解質構造体の一般構造は、次のものである。

【化 1】



(ここで、

L は非ペルフッ素化アルキル又はアルキレン - エーテル結合であり、

L' は結合又はアルキル若しくはアルキレン - エーテル結合であり、

n は 25 ~ 99 モル %、好ましくは 50 % 超、特に好ましくは 70 % 超であり、

m は 1 ~ 75 モル %、好ましくは 50 % 未満、特に好ましくは 30 % 未満であり、

A はスルホネート、ホスホネート又はカルボキシレートであり、

B は架橋し得る基である。)

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

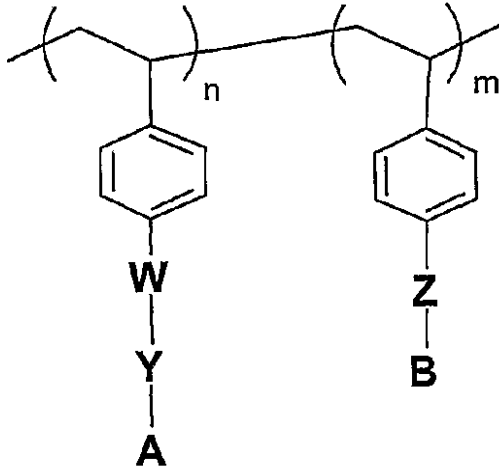
【補正方法】変更

【補正の内容】

【0032】

本発明のスチレンタイプの高分子電解質構造体の一般構造は、次のものである。

【化9】



(ここで、

Wは結合、O、NH、S、SO又はSO₂であり、

YはC₁～C₁₂のアルキル、芳香族又はアルキレン-エーテル結合(例えば(-CH₂-)₁₋₁₂)であり、

Zは結合、又はC₁～C₁₂のアルキル、芳香族若しくはアルキレン-エーテル結合であり、

nは1～99モル%、好ましくは50%超、特に好ましくは70%超であり、

mは1～99モル%、好ましくは50%未満、特に好ましくは30%未満であり、

Aはスルホネート、ホスホネート又はカルボキシレートであり、

Bは架橋し得る基である。)

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0091

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0091】

例14A：2-(4-ビニルフェニル)エタノール(2-VPE)

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0094

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0094】

例14B：ポリ(NaVBS)